



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ИСР ИСТОЧНИКОМ И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ПЛАЗМА ТМ 5

Назначение:

Плазмохимическое селективное (реактивно-ионное, анизотропное) травление диэлектрических и металлических плёнок.

Особенности:

- Обработка подложек в одном технологическом цикле: 60x48 мм - 3 шт.;
Ø 76,100,150,200 мм - 1 шт.
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, CF₄;
- Вращающийся ВЧ электрод с охлаждением подложек;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электродо-подложкодержателе от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ИСР источника плазмы в диапазоне 400-600 Вт;
- Безмасляная (сухая) откачка на базе форвакуумного и турбомолекулярного насосов;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 7 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~5 м².

